PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-172458

(43)Date of publication of application: 09.07.1993

(51)Int.Cl.

F25J 3/08 B01D 53/36

(21)Application number: 03-343340

(71)Applicant: KOBE STEEL LTD

(22)Date of filing:

25.12.1991

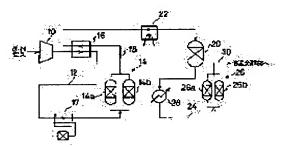
(72)Inventor: AYUHARA TOSHIYUKI

OYAMA TAKASHI FUJITA HIDETO TANAKA MASAYUKI

(54) IMPURITY REMOVING DEVICE FOR AIR SEPARATING DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To manufacture the ultra-high purity nitrogen by a method wherein carbon monoxide and hydrogen in raw material air are removed at a high level, in an air separating device. CONSTITUTION: An impurity removing device comprises a catalyst tower 20 to promote oxidation of carbon monoxide and hydrogen in raw material air and raw material air passages 12, 18, 24, and 34 through which raw material air flows to the catalyst tower 10. An adsorbing unit 14 to adsorb and remove hydrocarbon, carbon dioxide, and water which produce catalyst poison, from the raw material air is arranged at a position upstream of the catalyst tower 20.



(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-172458

(43)公開日 平成5年(1993)7月9日

(51)Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

F 2 5 J 3/08

8925-4D

B 0 1 D 53/36

104 Z 9042-4D

審査請求 未請求 請求項の数3(全 8 頁)

(21)出願番号

特願平3-343340

(22)出願日

平成3年(1991)12月25日

(71)出願人 000001199

株式会社神戸製鋼所

兵庫県神戸市中央区脇浜町1丁目3番18号

(72)発明者 鮎原 俊行

神戸市灘区新在家南町2-2-5

(72)発明者 大山 隆司

神戸市垂水区福田2-2-8

(72)発明者 藤田 秀人

兵庫県西宮市段上町3丁目8-20

(72) 発明者 田中 正幸

兵庫県宝塚市中山桜台6丁目15-1

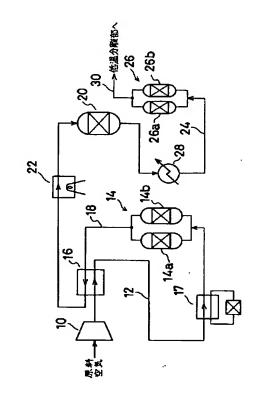
(74)代理人 弁理士 小谷 悦司 (外3名)

(54)【発明の名称】 空気分離装置における不純物除去装置

(57)【要約】

【目的】 空気分離装置において、原料空気中の一酸化 炭素及び水素を高レベルで除去することにより、超高純 度窒素の製造を可能にする。

【構成】 原料空気中の一酸化炭素及び水素の酸化を促 進させる触媒塔20と、この触媒塔20に原料空気を通 す原料空気通路12,18,24,34とを備えた不純 物除去装置。上記触媒塔20よりも上流側の位置に、上 記原料空気中から上記触媒塔20の触媒毒となる炭化水 素と二酸化炭素と水とを吸着除去する吸着ユニット14 を配置する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 空気分離装置に設けられ、その低温分離部に導入される前の原料空気から不純物を除去するための装置であって、上記原料空気中の一酸化炭素及び水素の酸化を促進させる触媒装置と、この触媒装置に原料空気を通して上記低温分離部へ導く原料空気通路とを備えるとともに、この原料空気通路において上記触媒装置よりも上流側の位置に、上記原料空気中から上記触媒装置の触媒毒となる炭化水素と二酸化炭素と水とを吸着除去する吸着装置を設けたことを特徴とする空気分離装置における不純物除去装置。

【請求項2】 請求項1記載の空気分離装置における不純物除去装置において、上記触媒装置と低温分離部との間に、原料空気中から二酸化炭素と水とを吸着除去し、かつその吸着容量が上記吸着装置の吸着容量よりも小さい副吸着装置を設けたことを特徴とする空気分離装置における不純物除去装置。

【請求項3】 請求項1記載の空気分離装置における不純物除去装置において、上記吸着装置に3つ以上の吸着塔を設け、各吸着塔の入口側に原料空気を導入するための第1の原料空気通路と、各吸着塔の出口側を上記触媒装置の入口側に接続する第2の原料空気通路と、上記触媒装置の出口側を各吸着塔の入口側に接続する第3の原料空気通路と、各吸着塔の出口側を上記低温分離部に接続する第4の原料空気通路とを備えるとともに、各吸着塔を、この吸着塔に上記第1の原料空気通路から原料空気が流入して上記第2の原料空気通路に流出する第1の使用状態と、上記吸着塔に第3の原料空気通路に流出する第2の使用状態と、再生状態とに切換える流路切換手段を備えたことを特徴とする空気分離装置における不純物除去装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、半導体製造用窒素等を 製造するための空気分離装置において、その低温分離部 に原料空気を導入する前に、予めこの原料空気から一酸 化炭素や水素等の不純物を除去しておくための装置に関 するものである。

[0002]

【従来の技術】一般に、原料空気から窒素を分離する窒素製造装置や空気分離装置は、保冷箱内に主熱交換器や精留塔が設置された低温分離部を備えており、この低温分離部に外部から原料空気が導入されることにより、窒素等の精製が行われるようになっている。

【0003】ところで、近年、半導体製造の活発化に伴い、超高純度窒素の需要が急速に高まっている。このような超高純度窒素を上記空気分離装置によって得ようとするには、その低温分離部に原料空気を導入する前に、この原料空気から予め一酸化炭素や水素といった不純物

を除去しておく必要がある。

【0004】従来、このような不純物を除去する手段としては、上記原料空気を白金系触媒やパラジウム系触媒等に通し、ここで一酸化炭素及び水素の酸化を促進してこれらを二酸化炭素及び水に変換するといったことが行われている(例えば1988年10月発行の日経マイクロデバイス別冊No.2「超クリーン技術」参照。)。

【0005】このような操作を行うための装置の一例を図3に示す。図において、圧縮機100により圧縮された原料空気は、熱交換器102で予熱され、さらに電気ヒータ104で加熱された後、触媒塔106へ導入される。この触媒塔106では、一酸化炭素及び水の酸化反応(燃焼反応)、すなわち、 $2CO+O_2 \rightarrow 2CO_2$ 、及び $2H_2+O_2 \rightarrow 2H_2O$ といった反応が促進され、これにより、原料空気中の一酸化炭素及び水素は、それぞれ二酸化炭素及び水に変換される。

【0006】その後、原料空気は、上記熱交換器10 2、水冷却器108、さらにはフロン冷凍機110で冷却され、モレキュラシーブ等の吸着剤を収容した吸着ユニット112へ導入される。この吸着ユニット112において、上記原料空気中に含まれる二酸化炭素及び水が吸着除去され、残りの原料空気は、主熱交換器や精留塔等を備えた図外の低温分離部へ導入される。

【0007】すなわち、この装置では、まず触媒塔106によって原料空気中の一酸化炭素及び水素が除去され、その後に吸着ユニット112によって二酸化炭素及び水が除去されるようになっている。

[0008]

40

【発明が解決しようとする課題】近年、半導体の集積度の向上が大きな課題とされているが、これに伴って窒素の純度も極めて高いレベルのものが要求されている。例えば、64MBのメモリが得られる程度まで半導体の集積度を向上させようとするには、その製造に使用される窒素中の一酸化炭素及び水素の濃度を1ppb レベルまで下げる必要がある。

【0009】しかしながら、前記図3に示した従来装置では、原料空気中の一酸化炭素及び水素の濃度を約10ppbレベルまでしか下げることができず、よって半導体の高集積化への対応が困難な状況となっている。その主な理由としては、①原料空気中に含まれる炭化水素分が触媒塔106における触媒毒となり、触媒の性能を比較的短時間で劣化させてしまうこと、②原料空気中の二酸化炭素濃度及び水分濃度が高いため、その分、一酸化炭素及び水素の酸化反応(2CO+O2→2CO2、及び2H2+O2→2H2O)が抑制されてしまうこと、が挙げられる。

【0010】本発明は、このような事情に鑑み、空気分離装置において、原料空気中の一酸化炭素及び水素を高レベルで除去することにより、超高純度窒素の製造を可能にすることができる装置を提供することを目的とす

2

る。

[0011]

【課題を解決するための手段】本発明は、空気分離装置に設けられ、その低温分離部に導入される前の原料空気から不純物を除去するための装置であって、上記原料空気中の一酸化炭素及び水素の酸化を促進させる触媒装置と、この触媒装置に原料空気を通して上記低温分離部へ導く原料空気通路とを備えるとともに、この原料空気通路において上記触媒装置よりも上流側の位置に、上記原料空気中から上記触媒装置の触媒毒となる炭化水素と二10酸化炭素と水とを吸着除去する吸着装置を設けたものである(請求項1)。

3

【0012】さらに、上記触媒装置と低温分離部との間 に、原料空気中から二酸化炭素と水とを吸着除去し、か つその吸着容量が上記吸着装置の吸着容量よりも小さい 副吸着装置を設けたり(請求項2)、上記吸着装置に3 つ以上の吸着塔を設け、各吸着塔の入口側に原料空気を 導入するための第1の原料空気通路と、各吸着塔の出口 側を上記触媒装置の入口側に接続する第2の原料空気通 路と、上記触媒装置の出口側を各吸着塔の入口側に接続 20 する第3の原料空気通路と、各吸着塔の出口側を上記低 温分離部に接続する第4の原料空気通路とを備えるとと もに、各吸着塔を、この吸着塔に上記第1の原料空気通 路から原料空気が流入して上記第2の原料空気通路に流 出する第1の使用状態と、上記吸着塔に第3の原料空気 通路から原料空気が流入して上記第4の原料空気通路に 流出する第2の使用状態と、再生状態とに切換える流路 切換手段を備えたりする(請求項3)ことにより、後述 のようなより優れた効果が得られる。

[0013]

【作用】まず、請求項1記載の装置によれば、原料空気が触媒装置に導入される前に、この触媒装置の触媒毒となる炭化水素が予め吸着装置において原料空気中から除去されるため、その後、原料空気が触媒装置に導入された際の触媒装置の劣化が抑えられる。また、上記吸着装置において二酸化炭素及び水も吸着除去され、原料空気中の二酸化炭素濃度及び水分濃度が著しく低減した状態で原料空気が触媒装置に導入されるため、この触媒装置において一酸化炭素及び水素の酸化反応(2CO+O2→2CO2、及び2H2+O2→2H2O)がさらに促進され、これにより一酸化炭素濃度及び水素濃度は大幅に軽減される。従って、この原料空気が低温分離部に導入されることにより、極めて純度の高い製品窒素が製造されることとなる。

【0014】なお、上記酸化反応により新たに二酸化炭素及び水が発生し、原料空気中に混在することになるが、これら二酸化炭素及び水の生成量は微量であり、しかもこれらは沸点が高くて低温分離部で確実に空気から分離されるため、その除去は必ずしも必要ではない。ただし、低温分離部で長時間の運転が行われると、上記二

酸化炭素や水が主熱交換器の通路内等で凍結し、ガスの 良好な流通を妨げるおそれがあるので、請求項2記載の 装置のように、触媒装置と低温分離部との間に副吸着装 置を設け、原料空気を触媒装置に通してから低温分離部 に導入するまでの間に、上記二酸化炭素及び水を再吸着 除去することが好ましい。この場合、上述のように二酸 化炭素及び水の量は微量であるため、副吸着装置には前 記吸着装置よりも吸着容量の低い小規模の装置を用いる ことが可能である。

【0015】また、請求項3記載の装置によれば、吸着 装置における各吸着塔の状態切換によって、触媒装置導 入前における原料空気からの不純物除去、及び触媒装置 通過後の不純物除去の双方を単一の吸着装置で連続的に 行うことができる。

【0016】例えば、最初の段階では第1の吸着塔を第1の使用状態、すなわち、この吸着塔に上記第1の原料空気通路から原料空気が流入して上記第2の原料空気通路に流出する状態に切換え、第2の吸着塔を第2の使用状態、すなわち、この吸着塔に第3の原料空気通路から原料空気が流入して上記第4の原料空気通路に流出する状態に切換え、第3の吸着塔を再生状態に切換えることにより、触媒装置前後における不純物除去を同時に行うことができる。

【0017】その後、第1の吸着塔については再生状態、第2の使用状態、第1の使用状態…の順に切換え、第2の吸着塔については第1の使用状態、再生状態、第2の使用状態…の順に切換え、第3の吸着塔については第2の使用状態、第1の使用状態、再生状態…の順に切換えていくことにより、これら3つの吸着塔を用いて、間に再生操作を適当に挾みながら、吸着除去操作を続行させることができる。

【0018】ここで、各状態の切換については、第2の使用状態、第1の使用状態、再生状態、第2の使用状態、…の順に行うことが望ましい。なぜならば、第2の使用状態で吸着塔が吸着する二酸化炭素量及び水分量は僅かであるため、この第2の使用状態からそのまま第1の使用状態に移行することは可能であるが、この第1の使用状態では比較的多量の不純物を吸着するため、次の吸着を行うには再生工程に移る必要があるからである。

[0019]

【実施例】本発明の第1実施例を図1に基づいて説明する。

【0020】ここに示す装置は、原料空気から窒素や酸素、アルゴン等を分離する空気分離装置において、その低温分離部(すなわち主熱交換器や精留塔が収容された保冷箱)に原料空気を導入する前に、この原料空気から予め一酸化炭素や水素といった不純物を除去するための装置を示したものである。なお、上記低温分離部については、通常知られている空気分離装置のそれと同等であるため、その図示を省略する。

5

【0021】図において、10は原料空気を圧縮する圧縮機であり、この圧縮機10は第1の原料空気通路12を介して吸着ユニット(吸着装置)14の入口側に接続され、第1の原料空気通路12の途中には熱交換器16及びフロン冷凍機17が設けられている。

【0.022】吸着ユニット14は、互いに並列に配された2つの吸着塔14a,14bを備え、これらの吸着塔14a,14bを備え、これらの吸着塔14a,14b内には、後述の触媒塔20において触媒毒となる炭化水素(CmHn)と、二酸化炭素と、水とを除去するための吸着剤が充填されている。この吸着剤としては、モレキュラシーブやアルミナゲル(温度スイング吸着を行う場合)、あるいは合成ゼオライト(圧力スイング吸着を行う場合)等が好適であるが、その種類は特に問わない。各吸着塔14a,14bの入口側及び出口側にはそれぞれ図外の弁が設けられており、一方の吸着塔14aにおいて吸着工程が行われる間に、他方の吸着塔14bにおいて図外の手段により再生工程が行われるようになっている。

【0023】上記吸着ユニット14は、第2の原料空気通路18を介して触媒塔20の入口側に接続されている。上記第2の原料空気通路18の途中には、上記熱交換器16及び電気ヒータ22が設けられており、熱交換器16において、第1の原料空気通路12を通る原料空気と第2の原料空気通路18を通る原料空気との間で熱交換が行われるようになっている。

【0024】上記触媒塔20内には、原料空気中の一酸化炭素の酸化反応(燃焼反応)、すなわち、2CO+O $2 \rightarrow 2CO_2$ という反応を促進させる触媒(例えば白金系触媒)と、原料空気中の水素の酸化反応(燃焼反応)、すなわち $2H_2+O_2 \rightarrow 2H_2O$ という反応を促進させる触媒(例えばパラジウム系触媒)が充填されている。

【0025】この触媒塔20の出口側は、第3の原料空気通路24を介して副吸着ユニット(副吸着装置)26の入口側に接続され、第3の原料空気通路24の途中には、水冷却器28が設けられている。

【0026】副吸着ユニット26は、上記吸着ユニット14と同様に、互いに並列に配された2つの吸着塔26a,26bには、原料空気中の二酸化炭素及び水を吸着除去するための吸着剤が充填されており、その吸着容量は上記吸着ユニット14における各吸着塔14a,14bの吸着容量よりも小さく設定されている。具体的には、後述のように触媒塔20における酸化反応で生じる二酸化炭素や水を吸着除去するのに十分な程度の吸着容量に設定されている。

【0027】この副吸着ユニット26も、上記吸着ユニット14と同様、一方の吸着塔で吸着工程が行われる間に、他方の吸着塔で再生工程が行われるようになっている。そして、各吸着塔26a,26bの出口側が第4の原料空気通路30を介して図外の低温分離部に接続され 50

るようになっている。

【0028】次に、この装置の作用を説明する。

【0029】まず、圧縮機10で圧縮された原料空気は、熱交換器16で予冷され、さらにフロン冷凍機17で冷却された後、吸着ユニット14の吸着塔14a(または14b)内に導入される。ここで、原料空気中に含まれる所定の炭化水素、すなわち、触媒塔20において触媒毒となり得る炭化水素が吸着除去されるとともに、二酸化炭素及び水も吸着除去される。

【0030】このようにして、上記炭化水素等の濃度が低減した原料空気は、熱交換器16及び電気ヒータ22で加熱された後、触媒塔20内に導入される。この触媒塔20内において、原料空気中に含まれる一酸化炭素及び水素の酸化反応が促進されることにより、これらはそれぞれ二酸化炭素及び水となって原料空気から分離され、除去される。

【0031】ここで、触媒塔20に導入される原料空気中からは、既に、触媒毒となり得る炭化水素が除去されているので、従来装置に比べて触媒塔20における触媒の劣化が著しく抑えられ、これにより触媒塔20の寿命が延長されるとともに、一酸化炭素及び水の酸化反応がより促進される。しかも、上記原料空気中からは、一酸化炭素及び水素の酸化反応の反応生成物である二酸化炭素及び水も予め除去されているので、上記酸化反応はより促進されることとなる。よって、この触媒塔20を通過する原料空気の一酸化炭素濃度及び水素濃度は極めて低い値、具体的には1ppbレベルまで削減することが可能となる。

【0032】この触媒塔20から排出された原料空気は、水冷却器28で冷却された後、副吸着ユニット26の吸着塔26a(または26b)に導入される。この吸着ユニット26により、上記触媒塔20における酸化反応で生成された微量の二酸化炭素及び水が再び吸着除去される。このようにして各不純物の濃度が下げられた原料空気は、第4の原料空気通路30を通じて低温分離部へ導入され、この低温分離部において上記原料空気から窒素等が精製される。

【0033】以上のように、この装置では、従来のように触媒塔に原料空気を通してから二酸化炭素及び水を吸着除去するのではなく、触媒塔20よりも上流側の位置に吸着ユニット14を配置し、この吸着ユニット14で二酸化炭素や水、さらには触媒毒である炭化水素を予め除去した後に上記触媒塔20へ原料空気を導入するようにしているので、従来装置に比べ、触媒塔20における一酸化炭素及び水素の酸化反応をより促進することができる。このため、低温分離部へ導入される原料空気中の一酸化炭素濃度及び水素濃度を大幅に低減させることができ、これによって超高純度窒素の製造を実現することができる。

【0034】さらに、この実施例では、触媒塔20を通

7

過した原料空気を副吸着ユニット26に通し、触媒塔2 0における反応で生成された二酸化炭素及び水を再吸着 除去するようにしているので、低温分離部における二酸 化炭素や水の凍結をより確実に防ぐことができる。しか も、触媒塔20で発生する二酸化炭素及び水の量は、当 初、原料空気に含まれている二酸化炭素や水の量に比べ て極めて少ないので、副吸着ユニット26の吸着塔26 a,26bには吸着ユニット14における吸着塔14 a,14bよりも小規模のものを用いることができ、よって、多大なコストの増大を伴うことなく上記効果を得 ることができる。

【0035】次に、第2実施例を図2に基づいて説明す る。

【0036】ここでは、上記第1実施例における吸着ユニット14及び副吸着ユニット26に代え、3つの吸着塔32a,32b,32cをもつ吸着ユニット32を設置し、この単一の吸着ユニット32によって、触媒塔導入前の原料空気からの不純物除去、及び触媒塔通過後の原料空気からの不純物除去の双方を行うようにしている。

【0037】具体的に、各吸着塔32a,32b,32cの入口側は、それぞれ弁(流路切換手段を構成)34a,34b,34c及び共通の第1の原料空気通路12を介して圧縮機10の出口側に接続されるとともに、弁36a,36b,36c(流路切換手段を構成)及び共通の第3の原料空気通路24を介して触媒塔20の出口側に接続されている。また、各吸着塔32a,32b,32cの出口側は、それぞれ弁(流路切換手段を構成)38a,38b,38c及び共通の第2の原料空気通路18を介して触媒塔20の入口側に接続されるとともに、弁40a,40b,40c(流路切換手段を構成)及び共通の第4の原料空気通路30を介して図外の低温分離部に接続されている。

【0038】次に、この装置による一酸化炭素及び水素の除去要領の一例を説明する。

【0039】まず、各弁のうち弁34a,36b,38 a,40bのみを開くとともに、吸着塔32c内には図外の手段を用いて再生用ガスを通す。これにより、圧縮機10で圧縮された原料空気は第1の原料空気通路12を通じて吸着塔32a内に導入され、ここで原料空気中の炭化水素、二酸化炭素、及び水が除去された後、残りの原料空気が第2の原料空気通路18を通じて触媒塔20に導入される。そして、この触媒塔20における酸化反応で原料空気中の一酸化炭素及び水素が除去された後、その生成物である微量の二酸化炭素及び水を含んだ原料空気が第3の原料空気通路24を通じて吸着塔32b内に導入され、この吸着塔32bで上記微量の二酸化炭素及び水が吸着除去された後に、残りの原料空気が第4の原料空気通路30を通じて図外の低温分離部へ導入される。この間、吸着塔32cにおいては、再生ガスに よる再生工程が行われる。

【0040】次に、上記吸着塔32aがほぼ破過した時 点で、上記弁34a, 36b, 38a, 40bを閉じる とともに、弁34b,36c,38b,40cを開き、 かつ、吸着塔32a内に再生用ガスを通す。これによ り、圧縮機10で圧縮された原料空気は第1の原料空気 通路12を通じて今度は吸着塔32b内に導入され、そ の後、第2の原料空気通路18、触媒塔20、及び第3 の原料空気通路24を経て吸着塔32c内に導入され る。この間、吸着塔32aにおいて再生工程が行われ る。すなわち、上記各弁の開閉切換により、吸着塔32 aは圧縮機10からの原料空気が導入される状態(第1 の使用状態)から再生状態に切換えられ、同様に、吸着 塔32bは触媒塔20からの原料空気が導入される状態 (第2の使用状態) から上記第1の使用状態に切換えら れ、吸着塔32cは再生状態から上記第2の使用状態に 切換えられることとなる。

【0041】上記吸着塔32bがほぼ破過した後は、上記弁34b,36c,38b,40cを閉じるとともに、弁34c,36a,38c,40aを開き、かつ、吸着塔32b内に再生用ガスを通すようにすればよい。これにより、吸着塔32aは上記再生状態から第2の使用状態に切換えられ、吸着塔32bは上記第1の使用状態から再生状態に切換えられ、吸着塔32cは上記第2の使用状態から第1の使用状態に切換えられることとなる。以下、このような切換を繰り返すことにより、3つの吸着塔32a,32b,32cを用いて、触媒塔20に導入する前の一酸化炭素及び水素の除去、触媒塔20通過後の一酸化炭素及び水素の除去、及び各吸着塔の再生工程を連続的に効率良く行うことができる。

【0042】ここで、各吸着塔の状態切換は、第2の使用状態、第1の使用状態、再生状態、第2の使用状態、…の順に行うことが肝要である。なぜならば、第2の使用状態では、触媒塔20で生成された微量の二酸化炭素及び水を吸着するだけであるので、そのまま続けて第1の使用状態に移行することができるのに対し、第1の使用状態では、元来原料空気に含まれている比較的多量の二酸化炭素、水、及び炭化水素を吸着除去するので、その後、再生操作が必要だからである。

【0043】すなわち、この装置は、触媒塔通過後の原料空気から二酸化炭素及び水を吸着除去する量が微量であることに着目し、各吸着塔を第2の使用状態、第1の使用状態、再生状態、第2の使用状態、…の順に切換えることにより、触媒塔20の前後における一酸化炭素及び水素の除去を単一の吸着ユニット32で効率良く行うことを可能にしたものであるといえる。

【0044】なお、前記第1実施例では、吸着ユニット 14及び副吸着ユニット26において、2つの吸着塔を 備えたものを示したが、吸着塔の具体的な数は問わず、 用途に応じて適宜設定すればよい。また、第2実施例に

٥

おける吸着ユニット32においては、吸着塔の数は3つ 以上の範囲で適宜設定することが可能である。

[0045]

【発明の効果】以上のように本発明は、従来のように触 媒装置に原料空気を通してから二酸化炭素及び水を吸着 除去するのではなく、触媒装置よりも上流側の位置に吸 着装置を配置し、この吸着装置で二酸化炭素や水、さら には上記触媒装置で触媒毒となり得る成分を予め除去し た後に上記触媒装置へ原料空気を導入するようにしてい るので、触媒装置における一酸化炭素及び水素の酸化反 10 応を従来に比して著しく促進することができ、これによ り、低温分離部へ導入される原料空気中の一酸化炭素濃 度及び水素濃度を大幅に低減させ、もって超高純度窒素 の製造を実現することができる効果がある。

【0046】さらに、請求項2記載の装置では、触媒装 置を通過した原料空気を副吸着装置に通し、触媒装置に おける反応で生成された二酸化炭素及び水を再吸着除去 するようにしているので、低温分離部における二酸化炭 素や水の凍結をより確実に防ぐことができる。しかも、 ² 触媒装置で発生する二酸化炭素及び水の量は、当初、原 20 料空気に含まれている二酸化炭素や水の量に比べて極め て少なく、副吸着装置は上記吸着塔よりも吸着容量の小 さい小規模のものを使用することができるので、多大な コストの増大を伴うことなく、上記効果を得ることがで きる。

【0047】また、請求項3記載の装置は、3つ以上の 吸着塔をもつ吸着装置を備えるとともに、各吸着塔を、 この吸着塔に触媒装置導入前の原料空気が導入される第 1の使用状態と、触媒装置通過後の原料空気が導入され

る第2の使用状態と、再生状態とに切換える流路切換手 段を備えたものであるので、各吸着塔を第2の使用状 態、第1の使用状態、再生状態の順に互いに位相をずら しながら切換えることにより、複数の吸着装置を用いる ことなく、単一の吸着装置によって触媒装置前後におけ る一酸化炭素及び水素の除去を効率良く行うことがで き、これによりコストの削減を図ることができる効果が

10

【図面の簡単な説明】

ある。

【図1】本発明の第1実施例における空気分離装置の不 純物除去装置を示すフローシートである。

【図2】第2実施例における空気分離装置の不純物除去 装置を示すフローシートである。

【図3】従来の空気分離装置の不純物除去装置の一例を 示すフローシートである。

【符号の説明】

- 12 第1の原料空気通路
- 14 吸着ユニット (吸着装置)
- 18 第2の原料空気通路
- 20 触媒塔(触媒装置)
- 24 第3の原料空気通路
- 26 副吸着ユニット (副吸着装置)
- 30 第4の原料空気通路
- 32 吸着ユニット (吸着装置)
- 32a, 32b, 32c 吸着塔
- 34a, 34b, 34c, 36a, 36b, 36c, 3
- 8a, 38b, 38c, 40a, 40b, 40c 弁 (流路切換手段)

